

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
G02F 1/136

(11)
(43)

10-2004-0033416
2004 04 28

(21) 10-2002-0062492
(22) 2002 10 14

(71) 136-1

(72) 1107-903

441-1

59-301

72-1106 704

(74)
:

(54)

; ; TFT TFT ; TFT
 ; ; TFT 1 ; TFT
 ; ; TFT 2 ;
 2 ; 2 1 1
 ; ;
 가 ; ;
 ; ;

1 1
 2a 2d
 3a 3d
 - -
 301 : 303 :
 305 : 307 :
 309a : 309b :
 311 : 313 : TFT
 315 : 1 317 : 1
 317b : 2 319 :
 321 : 323 :
 325 : (Buffer) 327 :
 329 : 329a :
 330 :

가 , 가

가 가 가

1 가 (10) (20)
 가 30

가

()

3a 3f

3a TFT(313) (303) (305) (303) (301) TFT(313)
 (305) (303) (309a, 309b) (307) (301) (311)

TFT(313) TFT(313) (309a) 1 (315) (317a) (315)

3b (309a) (315) 2 (317b) (319) TFT(313) (319) (321)

2 μ m 가 50 μ m (321)

(319) ()

3c AINd Mo (321) (319) 2 AINd Mo (317b) (321) (323)
 Mo AINd (325)

3d (329) (321) (329) (327) (321) (327)
 (323) 2 μ m

3e (329a) (321) (321) (3)

3f (329a) (329a) (321) (325) (330)

가 가 가

가

가 가

(57)

1.

;

TFT

;

TFT

;

TFT

1

;

;

TFT

2

;

2

1

2

;

2

1

;

;

가

;

;

;

;

2.

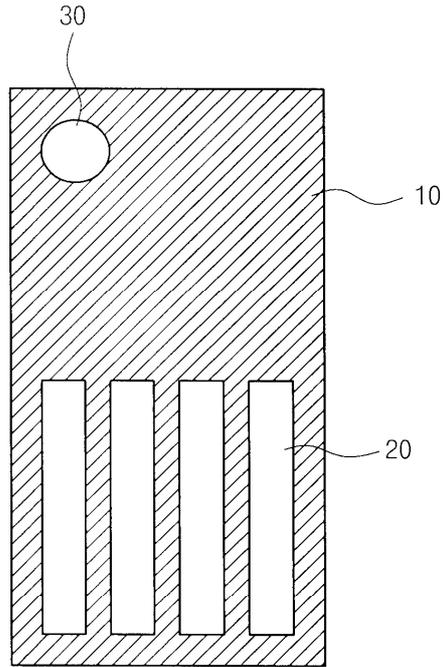
1

,

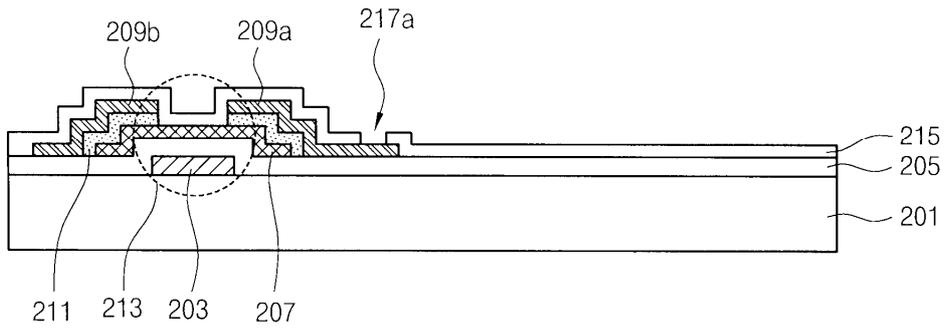
2 μ m

50 μ m

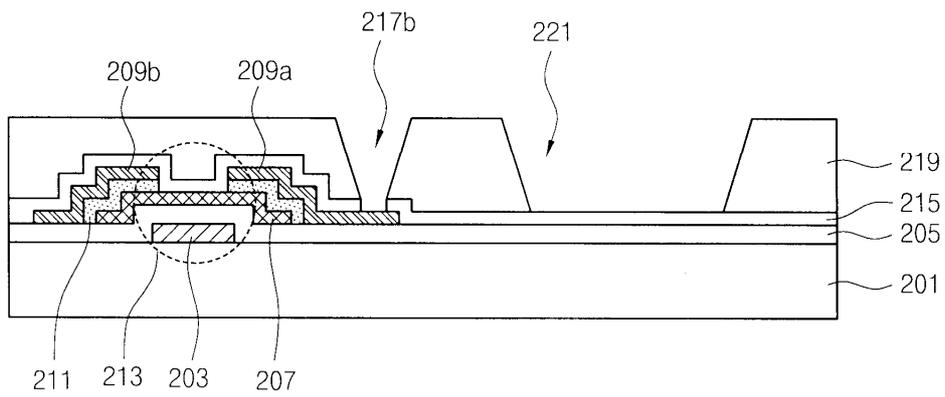
1

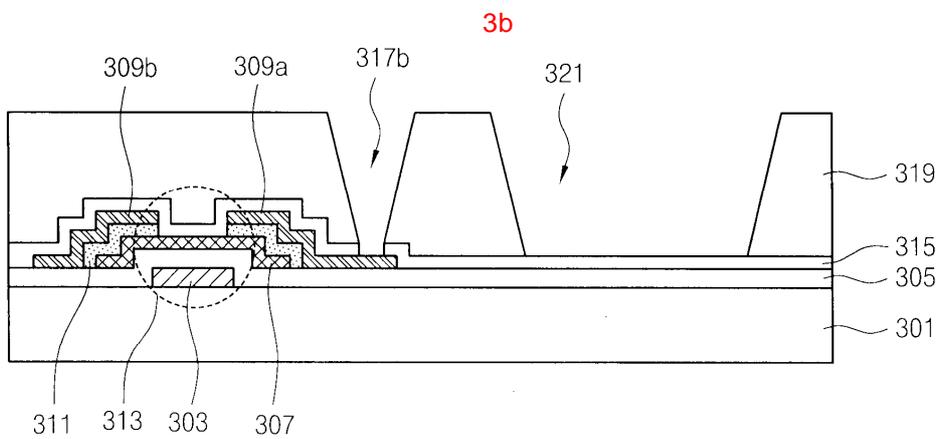
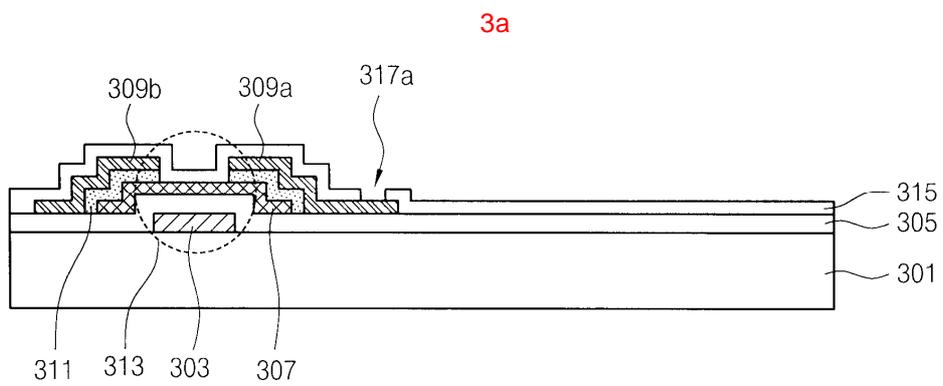
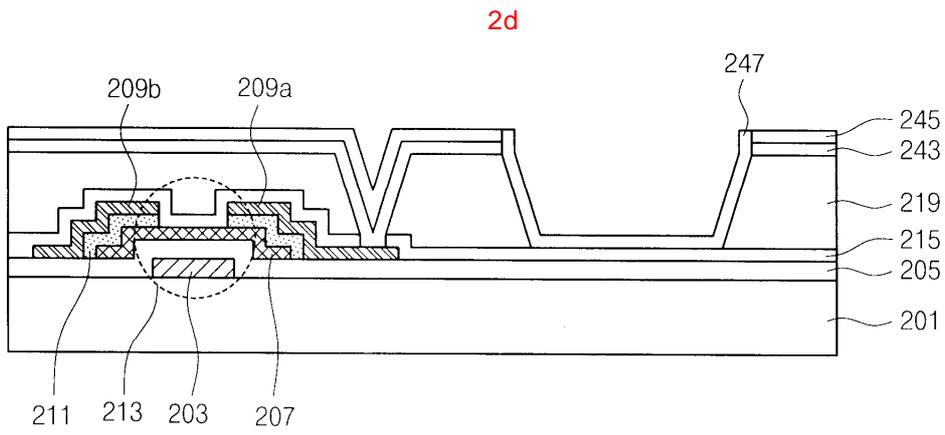
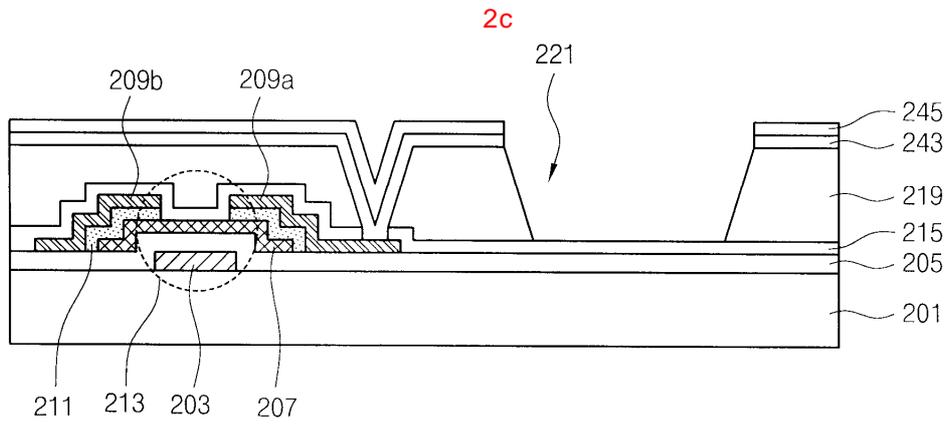


2a

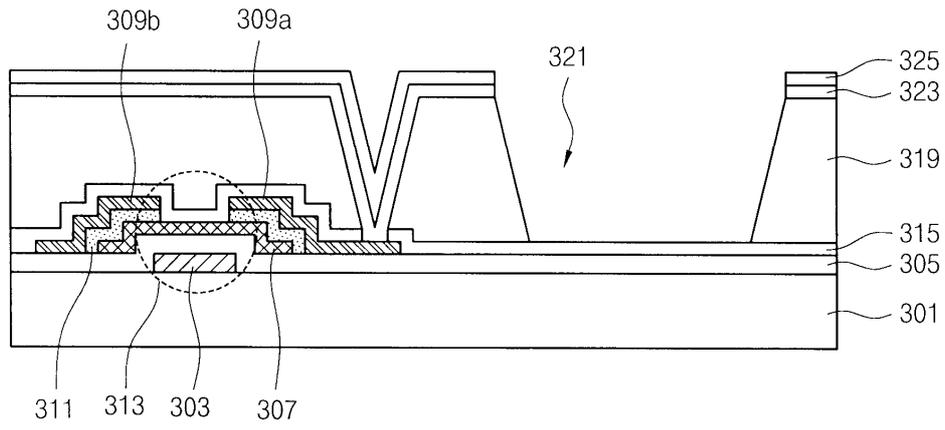


2b

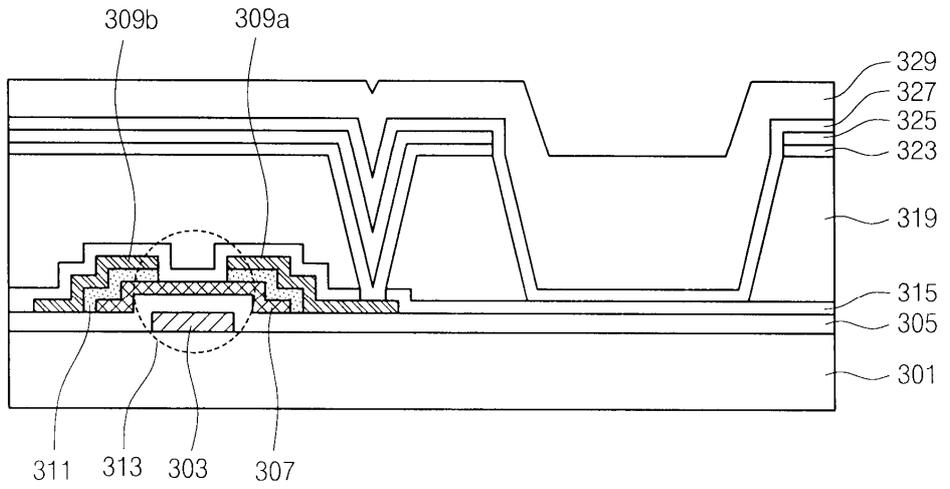




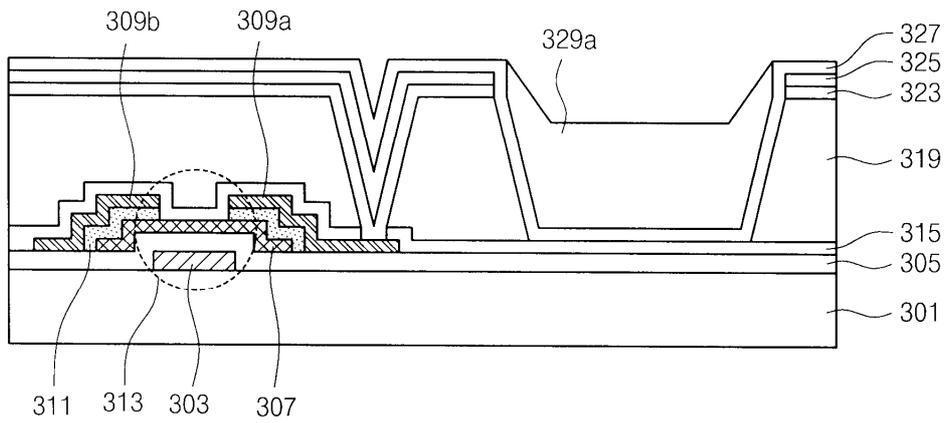
3c

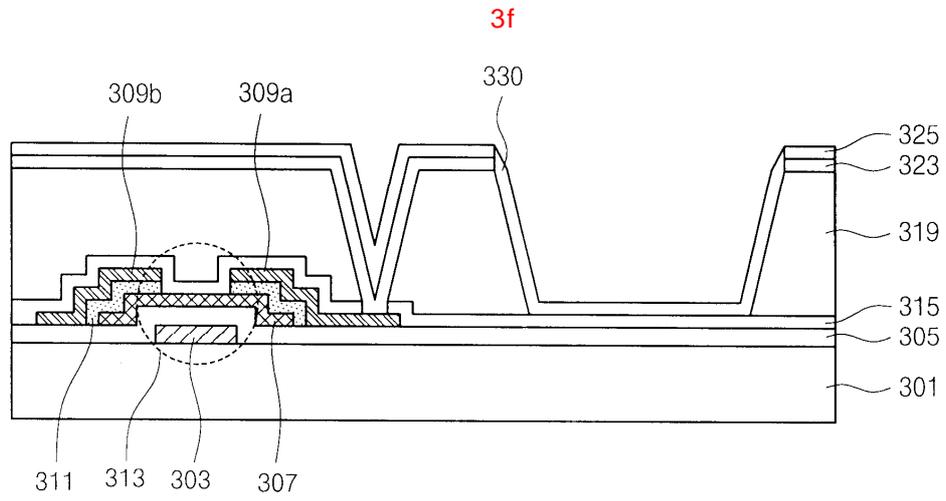


3d



3e





专利名称(译)	透射反射型液晶显示装置的制造方法		
公开(公告)号	KR1020040033416A	公开(公告)日	2004-04-28
申请号	KR1020020062492	申请日	2002-10-14
[标]申请(专利权)人(译)	HYDIS TECH HYDIS技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
[标]发明人	KIM KIYONG 김기용 CHOI HYUNMOOK 최현묵 RYU JAAIL 류재일 JUNG BONGKWAN 정봉관		
发明人	김기용 최현묵 류재일 정봉관		
IPC分类号	G02F1/136		
CPC分类号	G02F1/133555 G02F1/1343 G02F1/136 G02F2001/13625 G02F2203/09		
代理人(译)	赵龙HYUN		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明公开了一种减少掩模工艺数量的半透射型液晶显示器件的制造方法。提供透明型绝缘板的步骤，其中所公开的发明被透射区域和反射区域分割：在基板反射区域上的树脂膜部分上形成缓冲层和反射器的步骤，第二金属层和第一金属层连续沉积第二金属层的步骤的金属层：开口部分表面被去除：在电路板的结果上沉积透明金属膜的步骤上开口部分上的厚度的步骤：透明金属膜尽可能相对地，厚地涂覆光敏膜：在光敏膜正面露出的开口部分上的透明金属膜部分上形成光敏图案的步骤，并使其显影，并将光敏膜涂在缓冲层上去除衬底反射区域。通过使用光敏图案作为蚀刻阻挡壁来蚀刻在基板反射区域上的透明金属膜部分的开口部分中形成导体板的步骤，并且包括去除光敏图案的步骤。

